#### Prova orale del 15/07/2024

# TRACCIA N. 1

- 1) Ipotizzare le possibili cause e relative soluzioni nel caso in cui lo sviluppo di un fotoresist positivo presenti dimensioni inferiori a quelle nominali
- 2) Mettere a confronto le immagini ottenibili tramite detector di elettroni secondari rispetto a quelle ottenibili tramite detector di elettroni retrodiffusi
- 3) Descrivere la procedura ottimale per l'inserimento e posizionamento di una nuova apparecchiatura all'interno di una camera pulita

CG CF RR en

#### Prova orale del 15/07/2024

# TRACCIA N. 4

- 1) Mettere a confronto tecniche di litografia con e senza l'utilizzo di maschere
- 2) Descrivere le possibili procedure da mettere in atto per la gestione in camera pulita di campioni di un ente terzo che ha richiesto un service di microscopia elettronica
- 3) Descrivere le possibili cause e relative soluzioni nel caso il lettore di sovrapressione della camera pulita indichi un valore negativo



Prova orale del 15/07/2024

## TRACCIA N. 5

- 1) Mettere a confronto, evidenziando pregi e difetti, le tecniche CVD low pressure e Plasma enhanced
- 2) Descrivere la procedura da attivare nel caso sia necessario effettuare misure tramite ellissometria spettroscopica, di un materiale non presente nella libreria della macchina
- 3) Descrivere le possibili cause e relative soluzioni nel caso il lettore dell'umidità relativa all'interno della camera pulita indichi un valore sopra il 60%



#### Prova orale del 15/07/2024

## TRACCIA N. 6

- Descrivere un possibile metodo di gestione dei fotoresist evidenziando le potenziali criticità da minimizzare
- 2) Descrivere le possibili cause e relative soluzioni nel caso in cui un campione di vetro da analizzare al SEM risulti difficilmente analizzabile in quanto l'immagine risulta sovraesposta nonostante l'ottimizzazione dei parametri disponibili
- 3) Descrivere e confrontare un regime di flusso turbolento rispetto ad un regime di flusso laminare

Cg OF MZ CA

#### Prova orale del 15/07/2024

## TRACCIA N. 7

- Descrivere un possibile metodo per la gestione delle prenotazioni di una macchina ICP-RIE avente la possibilità di effettuare processi su wafer da 4 e da 6 pollici a fronte di un cambiamento configurazionale
- 2) Descrivere le possibili cause e relative soluzioni nel caso la camera del microscopio elettronico a scansione non vada in vuoto dopo il caricamento del campione
- 3) Descrivere gli effetti sul funzionamento dell'unità di trattamento aria nel caso una porta che collega la camera pulita all'esterno rimanga aperta (es. in caso di emergenza)

Cg CF12 Ch

#### Prova idoneità conoscenza applicazioni informatiche (15/07/2024)

### PROVA N. 1

- Aprire il file "Report Removal Rate CMP.docx" nella cartella "Prova Informatica 1".
- Applicare al testo "Report Removal Rate CMP" lo stile "Titolo 1"
- Inserire l'immagine "foto 1.jpeg" al posto del testo "FOTO1" e centrarla
- Aprire il file "Spessori ellissometria.xlsx". La tabella riporta per varie posizioni (pt1, pt2, etc) il valore dello spessore dell'ossido di silicio prima e dopo il trattamento.
- Calcolare:
  - 1. lo spessore medio dell'ossido prima del trattamento.
  - 2. lo spessore medio dell'ossido dopo il trattamento.
  - 3. Il valore medio del MRR. Inserire questo dato nel report al posto del testo "VALORE". Togliere l'evidenziazione gialla.
- Preparare un grafico di tipo "Dispersione con linee rette ed indicatori" con i valori di MRR per i diversi punti. Indicare come titolo dell'asse y "MRR / nm min-1", come titolo dell'asse X "Posizione lungo il wafer"
- Copiare il grafico nel report al posto del testo "GRAFICO" e centrarlo
- Salvare il file

Cg CF 12 CA

#### Prova idoneità conoscenza applicazioni informatiche (15/07/2024)

## PROVA N. 2

- Aprire il file "Report Microanalisi.docx" nella cartella "Prova Informatica 2".
- Applicare al testo " Figura 1: spettro EDS del campione " lo stile "Didascalia"
- Inserire l'immagine "spettro EDS.bmp " al posto del testo "Spettro EDS" e centrarla
- Aprire il file "Dati Microanalisi.xlsx ". La tabella riporta per i valori di area ottenuti in un punto per gli elementi manganese (Mn), nichel (Ni), e gallio (Ga) nei campioni A e B.
- Calcolare:
  - 1. la percentuale di ogni elemento in base ai valori di area, all'interno della tabella predisposta, sia per il campione A che per il campione B. Formattare le celle come percentuale. Copiare la tabella ottenuta nel report, al posto del testo "Tabella composizione"
- Preparare un grafico di tipo "Torta 2D" della percentuale dei tre elementi che costituiscono il campione A. Fare in modo che ad ogni colore venga associato il nome dell'elemento.
- Copiare il grafico nel report al posto del testo "GRAFICO" e centrarlo
- Salvare il file

Cg CRR2 th

#### Prova idoneità conoscenza applicazioni informatiche (15/07/2024)

### PROVA N. 4

- Aprire il file "Report dati PMMA.docx" nella cartella "Prova Informatica 4".
- Applicare al testo " Risultati rate PMMA" lo stile "Titolo1"
- Inserire l'immagine " 950 PMMA A Resist.jpeg" al posto del testo "DATASHEET.
- Aprire il file "Dati PMMA A4.xlsx". La tabella riporta i parametri di processo e lo spessore misurato per diverse velocità di spinnata per un polimero.
- Calcolare:
  - 1. la media geometrica per ciascuna velocità di rotazione. Copiare le colonne E-M della tabella ottenuta nel report, al posto del testo "Tabella"
- Preparare un grafico di tipo "Dispersione con linee curve e indicatori" con i valori medi degli spessori per le diverse velocità di spinnata. Indicare come titolo dell'asse y "Spessore resist / nm", come titolo dell'asse X "Velocità di rotazione / rpm".
- Copiare il grafico nel report al posto del testo "GRAFICO" e centrarlo
- Salvare il file



Prova idoneità conoscenza applicazioni informatiche (15/07/2024)

### PROVA N. 5

- Aprire il file "Report Removal Rate CMP.docx" nella cartella "Prova Informatica 5".
- Applicare al testo "Figura 1: fotografia del setup di misura MP" lo stile "Didascalia"
- Inserire l'immagine "foto 2.jpeg" al posto del testo "FOTO" e centrarla
- Aprire il file "Spessori ellissometria.xlsx". La tabella riporta per varie posizioni (pt1, pt2, etc) il valore dello spessore dell'ossido di silicio prima e dopo il trattamento.
- Calcolare:
  - 1. Il material removal rate (MRR) definito come (Spessore prima-spessore dopo)/tempo di processo, per ciascun punto
- Preparare un grafico di tipo "Dispersione con linee rette ed indicatori" con i valori di MRR per i diversi punti. Indicare come titolo dell'asse y "MRR / nm min-1", come titolo dell'asse X "Posizione lungo il wafer"
- Copiare il grafico nel report al posto del testo "GRAFICO" e centrarlo
- Salvare il file



#### Prova idoneità conoscenza applicazioni informatiche (15/07/2024)

### PROVA N. 7

- Aprire il file "Report Particelle 50Ce.docx" nella cartella "Prova Informatica 7".
- Applicare al testo "Figura 2: distribuzione della dimensione delle particelle " lo stile "Didascalia"
- Inserire l'immagine "Ce50\_50000X\_6.jpg" al posto del testo "FOTO1" e l'immagine "Ce50\_500000X\_17.jpg" al posto del testo "FOTO2". Affiancare le due immagini."
- Aprire il file " dimensione particelle.xls ". La tabella riporta le dimensioni riscontrate e la loro occorrenza.
- Calcolare:
  - 1. La dimensione delle particelle, come lunghezza delle particelle\*valore marker/lunghezza marker.
- Copiare la tabella con le occorrenze nel report, al posto del testo "Tabella"
- Preparare un grafico di tipo "Barre 2D" con i valori medi delle dimensioni delle sfere e la loro occorrenza. Indicare come titolo dell'asse x "Occorrenza", come titolo dell'asse y "Dimensione / nm"
- Copiare il grafico nel report al posto del testo "GRAFICO" e centrarlo
- Salvare il file

